

ナノインプリントの現状と課題 - パターン形成の本命になりうるか -

有機エレクトロニクス材料研究会 (JOEM)

【フォトポリマー懇話会との共催】

《日時》 2005年12月6日(火) 1時～5時

《会場》 大日本インキ化学工業(株) 本社ディックビル16階研修センター

(Web site: <http://www.dic.co.jp/company/img/nihonba.pdf> 地図参照)

(所在地: 中央区日本橋3-7-20 TEL:03-3272-4511)

《プログラム》

- 13:00～14:00 「ナノインプリント技術の現状と応用」(総論)
兵庫県立大 松井 真二
- 14:00～14:50 「各種インプリントモールドの作製」
NTT-ATN 出口 公吉
- 15:10～16:00 「ナノインプリント用樹脂の開発状況」
東洋合成工業 坂井 信支
- 16:00～16:50 「光ナノインプリント」
産総研 廣島 洋
- 16:50～17:00 補充討論・総括討論

参加費: 参加費、講演要旨集代は無料です。

会員以外は参加費として3,000円を当日受付にて申し受けます。

懇親会費: 今回は懇親会はありません。

参加登録: 参加登録、登録の変更は、11月28日(月)までに、次へお願いします。

(締切日後の参加申込は非会員扱いとなりますので

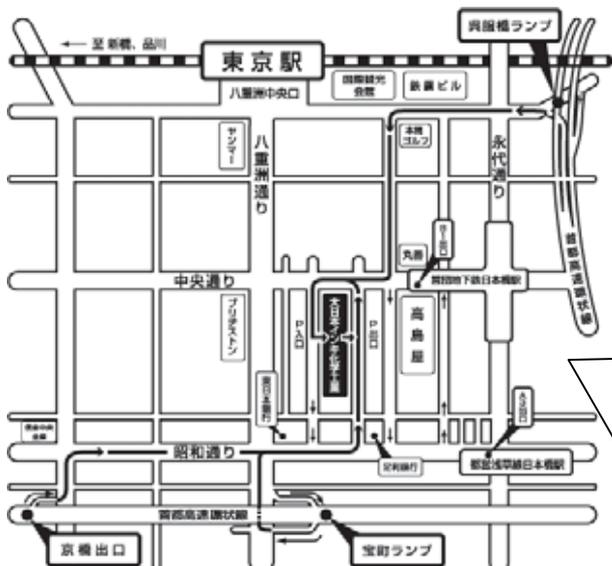
(1) Web site: <http://www.kt.rim.or.jp/~joem/> 経由『参加登録』画面

(Yahooなどでも検索できます)

(2) FAX: 0268-21-5413 (事務局のFAXとは異なります) (参加証は発行しません)

締め切り期日を過ぎてからの参加申し込みは要旨集を配布できない場合がございますのでご注意ください。

中間法人 有機エレクトロニクス材料研究会(The Japanese Research Association for Organic Electronics Materials)



【JR東京駅から】

東京駅八重洲中央口から八重洲通りを直進300m、
中央通りを左折して50m(徒歩5分)

【営団地下鉄銀座線、東西線日本橋駅から】

B1出口から銀座方向に直進100m(徒歩3分)

【都営地下鉄浅草線日本橋駅から】

A3出口から昭和通りを250m直進し、5つ目角を
右折150m(徒歩5分)

駐車場はディックビルの地下にありますので
ご利用ください。